Люминесцентные исследования кубического нитрида бора, легированного бериллием

© Е.М. Шишонок, Т. Taniguchi*, Т. Sekiguchi**

Институт физики твердого тела и полупроводников Национальной академии наук Белоруссии, 220072 Минск, Белоруссия * Advanced Laboratory, NIMS, Tsukuba, Japan ** NIMS, Tsukuba, Japan

E-mail: shishonok@ifttp.bas-net.by

(Поступила в Редакцию 6 июня 2006 г. В окончательной редакции 9 ноября 2006 г.)

Исследованы спектры катодолюминесценции и фотолюминесценции монокристаллов кубического нитрида бора cBN, легированных бериллием в условиях высоких давлений и температур. Установлено, что легирование бериллием приводит к стабильному образованию в спектрах катодолюминесценции cBN широкой полосы, положение максимума которой с увеличением концентрации примеси смещается в коротковолновую область спектра в интервале длин волн от ~ 315 до ~ 250 nm; при этом цвет кристаллов изменяется от темно-желтого до синего. По результатам исследований зависимостей структуры, интенсивности и положения максимума полосы от температуры измерения спектров катодолюминесценции предложена предварительная интерпретация ее природы в модели рекомбинации на дефектах донорного и акцепторного типов. Сделано предположение о присутствии вблизи валентной зоны легированного cBN нескольких перекрывающихся подзон, связанных с разнозарядными акцепторными уровнями бериллия. В спектрах фотолюминесценции легированных монокристаллов cBN зарегистрированы три неизвестные ранее бесфононные линии с энергиями 2.135, 2.27 и 2.60 eV.

Работа выполнена в рамках проекта 6-15 ГКПНИ "Нанометриалы и нанотехнологии" 2006-2010 гг. (Белоруссия) с использованием некоторых данных, полученных в рамках работы Е.М. Шишонок по STA grant (Japan).

PACS: 71.55.Eq, 74.25.Gz, 78.60.Hk, 78.55.-m

1. Введение

Кубический нитрид бора (cBN) известен как широкозонный полупроводник с уникальными свойствами, перспективный для использования в устройствах оптоэлектроники и микроэлектроники, работающих в экстремальных условиях высоких радиации и температуры, в химически агрессивных средах. Несмотря на возможные многофункциональные приложения (активные и пассивные элементы интегральных схем, устройства на основе поверхностных акустических волн (ПАВ), детекторы различного предназначения, теплопроводящие подложки, холодные эмиттеры и т.п.), практическое использование cBN сдерживается отсутствием кристаллов больших размеров, однофазных тонких пленок хорошего качества, наличием проблем легирования материала, отсутствием данных о его реальных свойствах и фундаментальных характеристик. Проблемы введения в кубический нитрид бора контролируемой примеси являются актуальными для использования cBN в названных практических приложениях.

В настоящее время примесью, существенно влияющей на некоторые оптические и электрические свойства *с* BN, следует считать бериллий. Неизвестна ни одна примесь, которая стабильно проявлялась бы в колебательном спектре *с* BN, кроме бериллия, образующего в спектре комбинационного рассеяния материала две широкие полосы при 215 и 535 сm⁻¹. Природа полос не определена однозначно [1,2]. Самостоятельных исследований люминесценции легированного бериллием *c*BN не проводилось, однако в спектрах катодолюминесценции (КЛ) *c*BN, легированного бериллием [3], были зафиксированы широкие полосы с максимумами от 3.5 до 3.7 eV. В нескольких работах исследовалась излучательная способность светодиода на *c*BN, область которого с проводимостью *p*-типа была получена путем легирования материала бериллием, так как для *c*BN и других полупроводников семейства A_3B_5 бериллий является надежным акцептором [4–8].

Ранее легированный бериллием *c*BN синтезировался в виде порошков, монокристаллов и поликристаллов [9,10]. Проведены исследования электрофизических свойств легированного бериллием материала (вольт-амперные и вольт-фарадные характеристики, эффект Холла) и обнаружено, что в кубическом нитриде бора с различным содержанием примеси бериллий, возможно, образует акцепторный уровень в интервале 0.25–1.03 eV [9]. Установлено, что с увеличением концентрации бериллия энергия активации примеси в *c*BN уменьшается.

В ряде работ предпринята попытка теоретически рассчитать энергетические состояния дефектов в *c*BN, включая примесь бериллия [11–17]. Например, показано, что атомы Ве замещают бор в решетке *c*BN с

формированием акцепторного уровня с энергией активации 0.11 eV. Замещение азота бериллием приводит к формированию акцепторного уровня в середине запрещенной зоны. Показано также, что энергия формирования разнозарядных состояний примеси бериллия в c BN является функцией энергии Ферми материала различной стехиометрии (избыточное содержание бора или азота в cBN позволяет говорить о материале с различной стехиометрией). В позиции бора Be_B имеет низкую энергию формирования, и для cBN с избытком бора и азота дефект Ве_в является доминантным. Донорный уровень бериллия в cBN может находиться на 5 eV выше валентной зоны. Для стехиометричного материала (т.е. материала с номинальным содержанием бора и азота) или материала р-типа отрицательно заряженный атом Ве в позиции бора также является доминирующим центром. Оцененная в одной из упомянутых работ энергия перехода для атома Ве в этой позиции из одного зарядового состояния в другие ("0"/"-") составила 0.4 eV, что находится в хорошем согласии с экспериментально полученным значением энергии активации [9] Ве-акцептора.

2. Эксперимент

Спектры КЛ с энергией возбуждающих электронов 10 keV регистрировались при температурах жидкого азота и гелия в диапазоне длин волн 200-800 nm, спектры фотолюминесценции (ФЛ) — при температуре жидкого азота в диапазоне 350-800 nm. Исследованные кристаллы были от черного и темно-синего до темно-желтого цвета, некоторые имели зональную окраску (мы ее называем также секторальной), когда кристаллы по форме представляли собой правильные шестиугольники с чередованием секторов темно-синего и желтого (либо светло-синего) цветов. Размеры исследованных кристаллов не превышали 200 µm. Все кристаллы были получены в технике высоких давлений. В работе использовались также данные по КЛ монокристаллов, легированных бериллием (представленных для исследования Т. Taniguchi), полученные во время работы E.M. Шишонок в рамках STA grant (Advanced Laboratory, NIMS, Japan).

3. Результаты и их обсуждение

На рис. 1, *а* представлен обзорный спектр КЛ, зарегистрированный на мозаике из нескольких монокристаллов *c*BN, легированных бериллием (далее *c*BN:Be), с секторальной окраской (синий и светло-синий цвета), в котором присутствует две широкие полосы с максимумами при ~ 450 и 300 nm. На этом же рисунке представлен спектр ФЛ в видимой области спектра, зарегистрированный на единичном монокристалле синего цвета. На рис. 1, *b* показаны спектры ФЛ монокристаллов *c*BN темно-синего и темно-желтого цветов, синтезированных



Рис. 1. Спектры КЛ и ФЛ различных монокристаллических образцов *c*BN: Ве при 77 К. *а* — КЛ мозаики из нескольких образцов *c*BN с зональной окраской и ФЛ единичного образца синего цвета с БФЛ при 2.60, 2.27 и 2.135 eV; *b* — спектры ФЛ образцов *c*BN синего (*1*, *5*) и желтого (2–4) цветов.

в одной и той же ростовой системе. Спектры ФЛ всех указанных образцов c BN : Ве представляют собой широкие полосы, максимумы которых существенно сдвинуты в длинноволновую область по сравнению с таковыми в нелегированных образцах c BN [18]. Положение максимума полосы в спектрах ФЛ кристаллов синего цвета фиксируется при ~ 560 nm (рис. 1, b, кривые 1, 5), а в спектрах желтых кристаллов — при ~ 630 nm (рис. 1, b, кривые 2–4). В спектрах желтых кристаллов c BN с меньшим содержанием бериллия по сравнению с кристаллами синего цвета [1] присутствует центр люминесценции GC-1, предположительно образованный вакансией азота [18].

На рис. 2, *а* показаны спектры КЛ в УФ-области, зарегистрированные на монокристаллах *с*ВN:Ве различного цвета: зонально-окрашенных (синий и светлосиний цвета) с содержанием примеси в исходной смеси 0.3 wt.% (кривая 1) и 0.60 wt.% (кривая 2), темно-желтого (кривые 3, 4) и темно-синего цветов (кривые 5, 6). На рис. 2, *b* показаны спектры, зафиксиро-



Рис. 2. Спектры КЛ различных монокристаллических образцов cBN:Be. a — мозаики из нескольких образцов cBN с зональной окраской (1, 2), темно-желтого (3, 4) и темно-синего (5, 6) цветов при 77 K; b — в областях синего (1) и желтого (2) цветов единичного образца при 25 K.

ванные в областях темно-синего (кривая *I*) и желтого цветов (кривая *2*) зонально-окрашенного монокристалла (NIMS, Japan). В спектрах всех упомянутых кристаллов наблюдается широкая полоса, положение максимума которой фиксируется в интервале длин волн от 250 до 315 nm, и центр люминесценции PF со структурированным спектром различной интенсивности [19].

В спектрах ФЛ некоторых кристаллов *c*BN:Ве (различного цвета) зарегистрированы неизвестные ранее центры люминесценции с узкими бесфононными линиями (БФЛ). Наиболее интенсивной из БФЛ является линия при 2.135 eV с полушириной $\Delta = 5$ meV, менее интенсивными — линии при 2.60 eV ($\Delta = 4$ meV) и 2.27 eV ($\Delta = 1$ meV).

К настоящему времени можно считать установленными, что по сравнению с алмазом кубический нитрид бора является более сложным объектом для исследований ввиду меньшей эффективности воздействия внешних факторов на его дефектную структуру. Так, облучение *c*BN электронами и ионами приводит к В настоящей работе установлено, что на *c*BN может быть получена интенсивная стабильная примесная люминесценция в глубокой УФ-области спектра $(hv \sim 5 \text{ eV})$ как отклик на легирование материала бериллием. Спектр люминесценции регистрируется в виде широкой асимметричной полосы шириной более 1 eV, иногда с видимой структурой, положение максимума которой не остается постоянным от образца к образиу и имеет тенденцию сдвига в коротковолновую область с увеличением в кристаллах содержания бериллия (рис. 2, *a*, кривые 1, 2) и, что то же самое, с изменением цвета кристаллов от желтого к синему (рис. 2, *a*, кривые 3–6). Поведение полосы в видимой области спектра легированных кристаллов имеет аналогичную тенденцию (рис. 1, *b*).

С целью исследования природы УФ-полосы в спектре cBN: Ве нами были изучены зависимости ее интенсивности и возможной структуры, а также положения ее максимума по энергии (в спектре одного из кристаллов) от температуры измерения КЛ в диапазоне 25–297 К (рис. 3, a).

Установлено, что с увеличением температуры измерения от 25 до 80-120 К максимум полосы смещается в коротковолновую область спектра на 0.035 eV, а с последующим ростом температуры до 297 К — в длинноволновую область на 0.060 eV (рис. 3, a, вставка).

Нами был произведен тщательный анализ структуры полосы путем ее разложения на компоненты (гауссианы) в спектрах одного и того же кристалла cBN:Be, зарегистрированных при различных температурах измерения КЛ. Оптимальным результатом разложения считался вариант, обеспечивающий минимальную ошибку ΔI при совмещении расчетного и экспериментального контуров полос при минимально возможном количестве компонент разложения для данного профиля полосы. Установлено, что полоса с максимумом при ~ 270 nm для всех температур измерения оптимальным образом разлагается на три составляющие полосы с максимумами при ~ 264 , ~ 292 и $\sim 312-330$ nm (рис. 4, *a*). Установлено также, что с изменением температуры измерения КЛ в указанном температурном диапазоне наблюдается монотонное перераспределение интенсивностей указанных компонент разложения от первоначального, с доминирующей коротковолновой полосой при $T = 25 \, \text{K}$, в сторону существенного увеличения интенсивностей длинноволновых полос (на вставке к рис. 4, а представлен вариант разложения полосы при $T = 200 \,\mathrm{K}$ на три компоненты) выше $T = 120 - 160 \,\mathrm{K}$. Перераспределение интенсивностей компонент является таковым, что положение максимума результирующей полосы, наблюдаемой в эксперименте, изменяется как показано на вставке рис. 3, *а*.

На рис. 3, *b* представлены кривые зависимостей относительной интенсивности каждой из трех полос (в частном случае аппроксимации контура полосы с максимумом при 270 nm тремя гауссианами) в полулогарифмическом масштабе от обратной температуры. На вставке к рисунку отдельно показана кривая изменения интенсивности полосы при 270 nm как целого. На каждой из кривых можно выделить дватри прямолинейных участка. С использованием закона Аррениуса были рассчитаны энергии активации процессов эффективного тушения люминесценции



Рис. 3. *а*) УФ-полоса в спектрах КЛ монокристаллического образца *c*BN: Ве при различных температурах *T*, К: *1* — 297, 2 — 270, 3 — 240, 4 — 200, 5 — 160, 6 — 120, 7 — 80, 8 — 40, 9 — 30, 10 — 25. На вставке — зависимость положения максимума полосы от температуры измерения КЛ. *b*) Зависимости натурального логарифма интенсивностей трех компонент разложения (264, 292, 312 nm) широкой полосы при 270 nm, нормированных на их интенсивность при *T* = 300 K, от обратной температуры. На вставке — то же для суммарной интенсивности широкой полосы 270 nm.



Рис. 4. УФ-полоса в спектрах КЛ монокристаллических образцов *c*BN:Ве при 25 К, представленная в варианте разложения на составляющие компоненты. *a* — с максимумом при 270 nm (на вставке — при 200 К); *b* — с максимумом при 250 nm.

каждой из полос (компонент разложения) в области температур 200–297 K, которые оказались равными: $\Delta E_1 = 0.031 \text{ eV} (297-200 \text{ K}), \Delta E_2 = 0.053 (200-80 \text{ K})$ и $\Delta E_3 = 0.045 \pm 0.0005 (80-25 \text{ K})$ соответственно для полос с максимумами при 265, 290 и 315 nm. Энергия активации тушения люминесценции всех полос при температурах 25–200 K составила 0.002–0.003 eV. Энергия активации тушения аппроксимируемой полосы с максимумом при 270 nm как целого на высокотемпературном участке составила 0.054 eV.

Поведение широкой УФ-полосы в спектре образцов cBN: Be, а именно сдвиг ее максимума в коротковолновую область спектра с ростом температуры измерения выше гелиевой, характерно для рекомбинации на донорно-акцепторных парах [22]. Последующий сдвиг упомянутой полосы в длинноволновую область может быть связан либо с фононным взаимодействием, активируемом при возрастании температуры измерения [23], либо с изменением заселенности примесных уровней и интенсификацией процессов рекомбинации на далеких



Рис. 5. Предположительная схема запрещенной зоны кубического нитрида бора, легированного бериллием. Показан донорный уровень E_D , электронные переходы с которого на акцепторный уровень E_A формируют в спектре КЛ электронно-колебательную структуру PF, а переходы в зону, состоящую из четырех перекрывающихся подзон акцепторных уровней бериллия (не показаны), — широкую УФ-полосу. Вставка *а* соответствует рис. 4, *a*, на вставке *b* приведены данные, представленные кривой 2 на рис. 2, *b*.

донорно-акцепторных парах. Естественно, что интерпретация природы УФ-полосы в спектре cBN: Ве в модели рекомбинации на дефектах донорного и акцепторного типов возможна при наличии донорного и акцепторного уровней в запрещенной зоне cBN. В этом случае смещение УФ-полосы в коротковолновую область с возрастанием концентрации бериллия качественно вполне согласуется с уменьшением энергии активации примеси бериллия при увеличении его концентрации в cBN (зафиксировано ранее при электрических измерениях [9]).

В рамках предложенной модели мы провели предварительную оценку энергии активации донорного уровня в запрещенной зоне cBN: Be, в спектре КЛ которого наблюдается полоса с максимумом при 270 nm. С использованием [24] получаем, что сумма энергий активации донорного и акцепторного уровней $E_A + E_D = E_g - E_{max}$ $= 6.4 \,\mathrm{eV} - 4.59 \,\mathrm{eV} = 1.81 \,\mathrm{eV}$, где E_g — ширина запрещенной зоны cBN, E_{max} — энергия, соответствующая максимуму полосы. Тушение люминесценции при температурах выше 200°С со средней энергией активации $\sim 0.054\,\mathrm{eV}$ может быть связано с уходом носителей с донорного уровня в зону проводимости или из валентной зоны на акцепторный уровень. Поскольку в отсутствие бериллия в кубическом нитриде бора электрической проводимости не регистрируется, из самых общих соображений (без учета структуры анализируемой полосы) величина энергии в 0.054 eV должна соответствовать энергетическому зазору между потолком валентной зоны и акцепторным уровнем бериллия в cBN. Поскольку анализируемая полоса имеет структуру и большую ширину, а энергетический интервал между компонентами ее разложения, узкими полосами, равен теоретически рассчитанному интервалу между разнозарядными акцепторными уровнями бериллия в *c* BN, можно допустить, что акцепторные уровни Ве образуют перекрывающиеся подзоны вблизи потолка валентной зоны со среднесуммарной полушириной ~ 1 eV. В этом случае величина энергии активации глубокого донорного уровня в схеме переходов уровень—зона может быть приблизительно оценена как $E_D = 1.81 \text{ eV} - E_A \approx 1.75 \text{ eV}.$

 $\bullet E_c$

Таким образом, наличие структуры полосы, состоящей из 3-4 более узких полос, видимо, подтверждает теоретические представления о том, что бериллий в *c*BN формирует несколько акцепторных состояний. Заметим, что в 6H-SiC [25] было обнаружено четыре (из теоретических расчетов известно о пяти) акцепторных уровня, образованных бериллием и его комплексами с энергиями в диапазоне 0.34-0.73 eV; известно о двух уровнях бериллия в кремнии, Ве образует мелкий акцепторный уровень $\Delta E_A = 0.06$ eV в вюрцитном GaN.

Обращает на себя внимание тот факт, что в спектрах КЛ, зарегистрированных в синей и желтой областях одного и того кристалла, наблюдаются соответственно либо интенсивная УФ-полоса, либо центр люминесценции РF. Спектры одноцветных кристаллов могут быть представлены суперпозицией упомянутых особенностей, т. е. одновременно содержат УФ-полосу и структуру PF различной интенсивности. Но чем больше бериллия в *c*BN, тем менее вероятно наблюдать в его спектре структуру PF. Природа центра PF ранее была интерпретирована в модели рекомбинации на дефектах донорного и акцепторного типов, предположительно имеющих собственную природу [19,26], где доноры — азотные вакансии, а акцепторы — атомы междоузельного бора. С одной стороны процессы рекомбинации с участием дефектов донорного и акцепторного типов, порождающих широкую УФ-полосу в спектрах люминесценции легированного бериллием *c*BN, конкурируют с аналогичными процессами на центрах PF. Это может означать, что первые из упомянутых процессов являются более вероятными. С другой стороны, присутствие бериллия в *c*BN может просто препятствовать образованию одного из дефектов, входящих в состав дефектов PF.

Поскольку бериллий в замещающей бор позиции является акцептором, донорами, участвующими в акте донорно-акцепторной рекомбинации с участием бериллия и одновременно формирующими донорноакцепторные пары PF, могут быть одни и те же дефекты, а именно вакансии азота. Отметим, что помимо дефектов PF в образцах с большим содержанием бериллия отсутствуют дефекты GC-1, в структуру которых также входят вакансии азота (рис. 1, b). Последнее может означать, что большинство азотных вакансий в сильно легированных образцах ассоциируется в донорно-акцепторные пары на основе бериллия. Воспользовавшись формулой из [24] и энергией активации донорного уровня (см. выше), возможно образованного вакансиями азота, мы рассчитали энергию активации акцепторов, с участием которых идут процессы рекомбинации на центрах PF. Она оказалась равной $E_A = E_g - E_{\text{max}} - E_D \approx 1.35 \,\text{eV},$ где $E_{\text{max}} = 3.4 \,\text{eV}$ — энергия максимума головной линии структуры PF, а $E_D = 1.75 \,\text{eV}$ (см. выше). Из сравнения энергий активации акцепторов, принимающих участие в вышеупомянутых процессах рекомбинации (0.054 и 1.35 eV), ясно, что электронные переходы с одного и того же донорного уровня (вакансии азота, не входящие в состав дефектов GC-1) на мелкие акцепторные уровни бериллия являются более вероятными, чем на более глубокий акцепторный уровень, с участием которого идут процессы рекомбинации на центрах PF. Заметим, что расчеты, проведенные в [12], показали донорную природу азотной вакансии в cBN. На рис. 5 мы приводит предположительную схему расположения донорного и акцепторных уровней в ширине запрещенной зоны cBN, легированного бериллием.

4. Заключение

Установлена эффективность легирования кубического нитрида бора бериллием со стабильным формированием в спектрах КЛ материала широкой полосы, положение максимума которой с увеличением концентрации примеси смещается в коротковолновую область спектра в интервале длин волн от 250 до 315 nm. При этом образование в кубическом нитриде бора центров люминесценции PF подавляется. По результатам исследований зависимостей структуры, интенсивности и положения максимума полосы от температуры измерения КЛ предложена предварительная интерпретация ее природы в модели рекомбинации на дефектах донорного и акцепторного типов. Выявленная структура полосы, обусловленная суперпозицией из трех-четырех узких полос с положением максимумов при ~ 225, ~ 245, $\sim 265, \sim 295$ или ~ 315 nm, а также рассчитанная энергия активации термического тушения люминесценции в максимуме полосы, равная 0,054 eV, позволили сделать предположение о присутствии вблизи валентной зоны легированного бериллием cBN нескольких перекрывающихся подзон, возможно связанных с разнозарядными акцепторными уровнями бериллия. Результаты, полученные в настоящей работе, позволяют контролировать процессы легирования cBN бериллием люминесцентными методами, что может представлять научный и практический интерес, а также способствовать продвижению материала к его использованию в практических приложениях.

Список литературы

- E.M. Shishonok, T. Taniguchi, K. Watanabe, H. Haneda, H. Kanda. Diamond Related Mater. 12, 1133 (2003).
- [2] Е.М. Шишонок. ЖПС 71, 803 (2004).
- [3] K. Era, O. Mishima. Mat. Res. Symp. Proc. 162, 556 (1990).
- [4] E.M. Shishonok, J.W. Steeds. Abstracts Int. Conf. "Doping issues in wide band-gap semiconductors". Exeter, U.K. (2001). P. 7.
- [5] Н.Д. Тяпкина, М.М. Кривополенова, В.С. Вавилов. ФТТ 6, 2192 (1964).
- [6] J.B. Robertson, R.K. Franks. Solid State Commun. 6, 625 (1967).
- [7] J.B. Robertson. Bull. Am. Phys. Soc. 13, A 1475 (1968).
- [8] R.K. Franks, J.B. Robertson. Solid State Commun. 6, 479 (1967).
- [9] T. Taniguchi, J. Tanaka, O. Mishima, T. Ohsawa, S. Yamaoka. Diamond Related Mater. 2, 1473 (1993).
- [10] L.M. Gameza. High Press. Res. 18, 373 (2000).
- [11] P. Piquini, R. Mota, T. Schmidt, A. Fazzio. Phys. Rev. B 56, 3556 (1997).
- [12] V.A. Gubanov, Z.W. Lu, B.M. Klein, C.Y. Fong. Phys. Rev. B 53, 4377 (1996).
- [13] I.A. Huward. Solid State Commun. 99, 697 (1996).
- [14] L.P. Castineira, T.R. Leite, J.L.F. Silva, L.M.R. Scolfard, J.L.A. Alves, H.W.L. Alves. Phys. Stat. Sol. (b) 210, 401 (1998).
- [15] I. Gorczyca, A. Svane, N.E. Christiansen. Nitride Semiconductor Res. Internet journal. 3, article 48 (1998).
- [16] W. Hayes, A. Spray. Proc. Int. Conf. "Localized exitation in solids". N.Y. (1968). P. 140.
- [17] B. Clerjaud, D. Cfte, C. Naud, R. Bouanani-Rahbi, D. Wasik, T. Suski, E. Litwin-Staszevska, M. Bockowski, I. Grzrgory. Abstarcts Int. Conf. "Doping issues in wide band-gap semiconductors". Exeter, U.K. (2001). P. 4.

Физика твердого тела, 2007, том 49, вып. 10

- [18] Е.М. Шишонок, В.Б. Шипило, А.М. Зайцев, Н.Г. Аниченко. Изв. АН СССР. Неорган. материалы 26, 1651 (1990).
- [19] Е.М. Шишонок, В.Б. Шипило, А.И. Лукомский. ЖПС 53, 552 (1990).
- [20] A.M. Zaitsev, A.A. Melnikov, E.M. Shishonok, V.B. Shipilo. Phys. Stat. Sol. (a) 94, 125 (1985).
- [21] E.M. Shishonok, J.W. Steeds. Diamond Related Mater. 11, 1774 (2002).
- [22] S.J. Chung, O.H. Cha, C.-H. Hong, E.-K. Suh, B.H. Kim. J. Corea Phys. Soc. 37, 1003 (2000).
- [23] Ж. Панков. Оптические процессы в полупроводниках. М. (1973). 456 с.
- [24] N.M. Gasanly, A. Serpenguzel, A. Audini, O. Gurtu, I. Yilmaz. J. Appl. Phys. 85, 3198 (1999).
- [25] X.D. Chen, C.C. Ling, S. Fung, C.D. Beling, M. Gong, T. Henkel, H. Tanoue, N. Kobajashi. J. Appl. Phys. 93, 3117 (2003).
- [26] Е.М. Шишонок, Дж. Стидс. ЖПС 70, 651 (2003).